

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年12月24日(2015.12.24)

【公開番号】特開2015-26688(P2015-26688A)

【公開日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【年通号数】公開・登録公報2015-008

【出願番号】特願2013-154703(P2013-154703)

【国際特許分類】

H 01 L 21/683 (2006.01)

H 01 L 21/304 (2006.01)

H 01 L 21/68 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 N

H 01 L 21/304 6 4 8 G

H 01 L 21/68 F

【手続補正書】

【提出日】平成27年11月9日(2015.11.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

本発明はこのような事情の下になされたものであり、その目的は、投光部及び受光部の汚染を避けつつ、基板の姿勢を検出することが可能な液処理装置を提供することにある。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 9】

回転軸222は、保持ピン221の上端部が回転プレート21の径方向内側へ向けて移動する方向に付勢されており、この付勢力により他の保持ピン221との間でウエハWを挟み、回転プレート21の上面との間に隙間を開けた状態でウエハWを水平に保持する。各作動片223の下方位置には、連結板253、棒状の昇降部材252を介して昇降機構254に連結された円環形状の押上板251が設けられている。この押上板251を上昇させて、作動片223を押し上げると、回転軸222周りに保持ピン221が回転し、回転プレート21の径方向外側へ向けて保持ピン221が移動することにより、ウエハWの保持が解除される(図4)。